

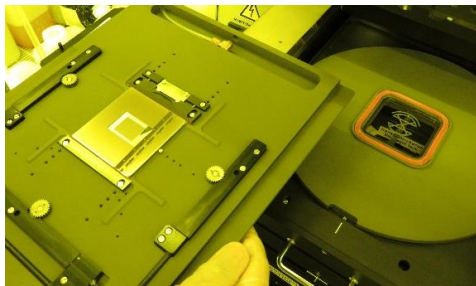
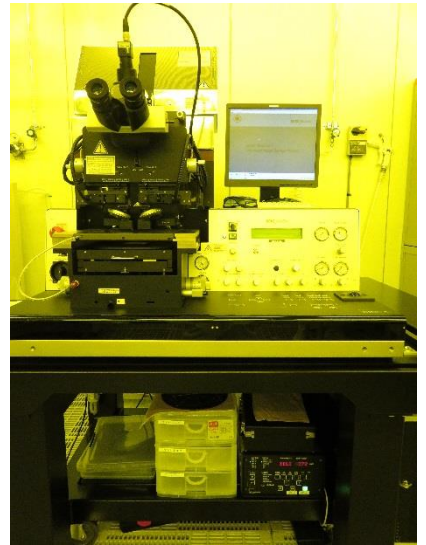
加工 (フォトリソ装置群)

両面マスクアライナ装置

ズース・マイクロテック社製 MA6/BA6

仕様

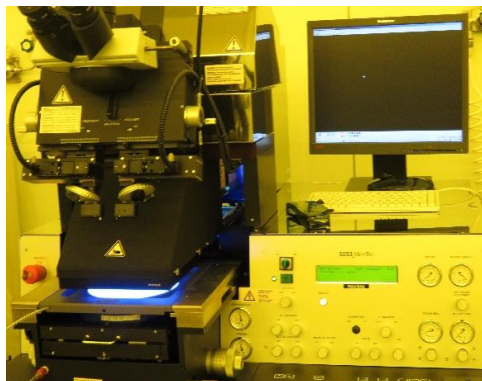
フォトマスクサイズ	2.5インチ～6インチ角
ウエハサイズ	10mm角～φ6インチ
基板	最大3mm
アライメント精度	TSA: 1.0 μ m以下、BSA: 1.5 μ m以下
解像力	2 μ m L/S (ハードコンタクトモード)
有効露光エリア	30mm角、40mm角、φ100mm
露光用光	LAMP Hg 350W、23mw/cm ²
波長域	350～450nmのブロードバンド(i線フィルタあり)



両面露光

本装置はウエハの表面と裏面にアライメント光学系を配置し、ウエハ裏面のパターンに合わせて、対応するウエハ表面に『ソフトコンタクト』『ハードコンタクト』『バキュームコンタクト』『プロキシミティ』で露光が行えます。上下に配置した双対物レンズをもつ光学系によりマスクとウエハのアライメントが確実に行えます。

また、対物レンズの間隔は可変できますので不定形ウエハに対しても、任意の間隔でアライメントが可能です。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX: 087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp